

特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所 / SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2026-09

ハイライト：

偽の実験データ・横取り特許に終止符...「不正特許」を一掃へ	1
エムプラス、大法院にて最終勝訴...110億ウォンの損害賠償が確定	3
POSTECH、イオン利用率を100%まで高めたバイオセンサー技術を開発	4
海外で偽物のK-ブランドを見つけたら、「写真に撮って教えて」	5
「ウリハルメは自分の商標だ」と提訴...法院「特定の個人が独占できるものではない」	6



IP制度

偽の実験データ・横取り特許に終止符

「不正特許」を一掃へ

信義誠実の原則の特許法に明文化・虚偽出願の刑事罰を強化...不正特許は共同審査で事前阻止

虚偽の実験データを提出したり、他人の技術を横取りして特許を出願する、いわゆる「不正特許」に対する制

裁が大幅に強化される。今後、信義誠実の原則に違反して特許を取得した場合、特許全体が無効処理される可能性があり、繰り返される欺瞞行為に対しては刑事罰も一段と強化される見通しである。

知識財産処は、特許制度の信頼性を損なう不正な特許出願行為を根絶するため、特許法に信義誠実の原則を新設し、虚偽行為の罪に関する規定を整備する一方、審査手続きを改善する制度改正を推進すると明らかにした。

今回の制度改正は、虚偽資料を用いた特許取得や技術の盗用、審査制度の弱点を悪用した不正な出願などを遮断し、正当な発明と公正な特許エコシステムを構築することに焦点が当てられた。

現在は、虚偽の実験データが含まれた明細書で特許登録を受けた場合でも、訴訟や無効審判の過程で問

特許の信頼性を損なう不正な出願行為を根絶



①信義誠実遵守の原則を導入

- 信義誠実遵守の原則を明文化し、違反時の拒絶手続きを整備
- 虚偽資料を用いて登録された特許は無効化など

②虚偽行為の処罰を強化

- 処罰対象を拡大し*、行為類型を明確化および量刑を強化**
- * [現行]特許決定を受けた者のみ処罰
→[改正]特許決定を受けていなくても、虚偽行為を繰り返した場合は処罰
- ** [現行]3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
→[改正]5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

③諮問型共同審査

- 審査官を欺くため、中核技術とは無関係な他分野から無意味かつ実施不可能な構成を盛り込む抜け道的な特許を防ぐ審査手続きを新設



題となった部分のみを削除すれば、特許権が維持される事例が発生する可能性がある。

知識財産処は、こうした問題を改善するため、虚偽の資料が含まれた明細書で登録された特許が確認された場合、当該特許の訂正を認めずに特許全体を無効とするよう制度を整備する計画である。

また、審査過程において信義誠実の原則違反が疑われる出願については、拒絶理由を通知し、出願人が自ら正当な出願であることを立証するよう求める手続きも設ける方針である。

技術資料を盗用したり、あまり知られていない他人の発明を自身の技術であるかのように出願する行為に対する処罰も強化される。

現行の特許法では、「虚偽その他の不正な行為」という表現が抽象的であり、処罰対象も「特許決定を受けた者」に限定されているため、実際の技術盗用や虚偽出願を効果的に制裁することが難しいという指摘がなされてきた。

これを受け、知識財産処は、処罰対象となる虚偽行為の類型をより具体的に規定し、特許が最終的に登録されなくても、繰り返し欺瞞行為を行った場合には処罰できるよう法改正を推進する。

刑事罰の水準も大幅に引き上げられる。現行の3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金から、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金へと強化し、欺瞞行為に対する抑止力を高める方針である。

審査制度の弱点を利用した抜け道的な出願も、集中管理の対象となる。

例えば、機械装置の発明と技術的関連性の低い化学組成物などを単に組み合わせ、審査の弱点を狙ういわゆる「単純な複合技術の特許出願」については、技術分野ごとの審査官が共同で検討する「諮問型協業審査」を導入する。

これにより、技術的な実体を欠く複合出願を登録段階からふるいにかけて、特許の品質を高めていく方針である。

すでに登録されている不正特許に対しても、対応が強化される。

知識財産処は、他の技術分野の専門審査官と協力し、職権で無効審判の請求ができるようにするとともに、無効審判後に特許法院で行われる審決取消訴訟については、訴訟専門担当官が専任で担当するよう改善する計画である。

これにより、審査官の訴訟負担を減らし、職権による無効審判制度をより積極的に活用できるよう支援するという説明である。

知識財産処は、今回の制度改正が特許行政の信頼性を高め、誠実な研究開発と公正な競争環境の構築に寄与するものと期待している。

知識財産処は、「不正な方法で特許を取得しようとする行為は、知的財産行政の信頼を損なう深刻な問題だ」とし、「今後も不正特許を徹底的に排除し、誠実な発明者や企業の真の技術が正当に保護される特許制度を築いていく」と明らかにした。



エムプラス、大法院にて最終勝訴

110億ウォンの損害賠償が確定

二次電池組立装備専門企業のエムプラスが、競合他社であるA社を相手取って提起した特許権侵害訴訟で、大法院の最終勝訴判決を受け、110億ウォン(約12億円)規模の損害賠償債権を確保した。同社は今回の判決を機に、中核特許の保護を強化するとともに、全固体電池の装備や自律産業移動ロボット(AIMR)などの新事業の拡大にも拍車をかける計画である。

エムプラスは、A社を相手取って提起した特許権侵害差

止などの請求訴訟において、大法院が双方の上告をいずれも棄却し、特許法院の判決が最終的に確定したと明らかにした。

訴訟の対象は、エムプラスが保有する「二次電池用極板スタッキング装置」の特許であり、同技術は、二次電池の組立工程における中核技術である極板スタッキング装置に関するものである。

特許法院は2026年2月、A社の実施製品が同特許の権利範囲に属すると判断し、エムプラスの主張を認めた。大法院も、A社が提起した特許の進歩性を否定する主張および裁判上の自白を取り消すという主張をいずれも認めず、原審判決を確定した。

損害賠償額の算定に関しても、旧特許法第128条第7項による110億ウォンの損害額の認定が適法であると判断した。これにより、エムプラスがA社に対して有する110億ウォン規模の損害賠償債権も最終的に確定した。

エムプラス側は、A社が企業再生手続きにおいて当該債権を再生計画に反映させる必要があり、今後も再生手続きの中で債権保全のための法的手続きを継続する方針であると説明した。

エムプラスの関係者は、「今回の大法院での最終勝訴は、長期間にわたる研究開発を通じて蓄積した中核的技術力と知的財産権が認められた結果である」とし、「技術革新を通じてグローバルな二次電池装備市場での競争力を強化するとともに、知的財産権の保護にもさらに積極的に取り組んでいく」と述べた。

なお、エムプラスは現在約140件の特許権を保有しており、持続的な研究開発を通じて新たな知的財産(IP)の確保に注力している。また、二次電池組立装備技術を基に、全固体電池装備や自律産業移動ロボット(AIMR)などの新事業へと事業ポートフォリオを拡大している。





最新技術

POSTECH、イオン利用率を100%まで高めた バイオセンサー技術を開発

イオン・半導体主鎖間の距離を調節してドーピング効率 100%を実現...性能低下の原因を初めて解明

次世代ウェアラブルバイオセンサーの感度を低下させていた原因が初めて明らかになり、すべてのイオンが電気信号の生成に関与する高性能素子が開発された。

POSTECH(浦項工科大学)化学工学科の研究チームは、ソウル大学化学科、米国ノースカロライナ大学化学科、京畿大学化学科の研究チームと共同で、未来型バイオセンサーの中核部品である「有機電気化学トランジスタ」の性能を制限する原因を解明し、これを改善した高性能素子を開発したと明らかにした。

今回の研究成果は、国際学術誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。

トランジスタは、スマートフォンやコンピュータなどの電子機器において電流の流れを調節する部品である。有機電気化学トランジスタは、イオンの動きを電流信号に変換する機能を加えた素子であり、柔軟で低電圧でも作動するため、心拍や脳波、汗や血液中の生体信号を検知する次世代ウェアラブルバイオセンサー技術として注目されている。

これまでは、半導体内部に入ったイオンはすべて電気信号の生成に使用されると考えられていた。しかし、研究チームが開発した分光学的分析法で確認した結果、実際に電気信号の生成に寄与するイオンは半分程度に過ぎなかった。残りのイオンは、半導体内部に入っても電荷を生成するのに十分に活用されず、センサーの感度を低下させていた。

その原因は、イオンと高分子半導体の主鎖との距離に

あった。主鎖は、実際に電気信号が生成される高分子半導体の本体構造であり、イオンが近くに接近するほど電荷がより円滑に生成される。

しかし、従来広く使用されてきたオリゴエチレングリコール(OEG)側鎖は、イオンを半導体内部へうまく取り込む一方で、主鎖に接近することを妨げることが明らかになった。側鎖とは、高分子の主鎖に結合している枝分かれの構造である。

研究チームはこれを解決するため、半導体薄膜が形成された後に構造が変化する高分子半導体を設計した。薄膜形成後、長い側鎖が除去され、短いカルボン酸基のみが残るようにすることで、イオンを取り込む性質は維持しつつ主鎖に接近できるようにした。

実験の結果、半導体内部に入ったイオンがすべて電気信号の生成に関与する、100%のドーピング効率を達成した。ドーピングとは、半導体内部に電荷を生成し、電流が流れるようにする過程である。

研究チームは、スーパーコンピュータを用いた分子動力学シミュレーションを通じて、イオンと主鎖との距離が近くなるほどドーピング効率が高まるという原理も確認した。

この技術を適用した有機電気化学トランジスタは、これまでに報告された素子の中で最高水準となる280S/cmのトランスコンダクタンスを記録した。トランスコンダクタンスとは、イオンの動きを電流信号へどれだけ高い感度で変換できるかを示す性能指標である。

今回の研究は、より高感度かつ高精度なウェアラブルバイオセンサーや医療診断機器の開発に向けた、新たな素材設計の原理を提示したとして評価されている。

POSTECH化学工学科のチョン教授は、「電気化学バイオセンサー用高分子半導体の設計において、ドーピング効率という新たな基準を提示した成果である」と述べた。

分子動力学の研究を主導したソウル大学化学科のソン教授は、「生体イオン信号が電流信号に変換される効率を分子レベルで解明した」とし、「次世代の生体電子素子の開発に向けた素材設計の指針となることを期待している」と述べた。



商 標

海外で偽物のK-ブランドを見つけたら

「写真に撮って教えて」

・ 知識財産処、7月30日に「K-ブランド偽造品通報センター」を開設

・ 見つけて撮って投稿...国民からの通報は企業に迅速に伝えられ、現地の法的対応まで連携

・ 「K-ブランド保護サービス」を通じて、海外での商標の無断先取りリスクを事前に警告

海外旅行中に韓国の商標を模倣した偽の店舗を発見したら、どうすればよいだろうか。これからは携帯電話で店舗を撮影して手軽に通報できる。国民から寄せられた疑わしい事例は、専門家の検討後に当該企業に通報され、必要であれば現地対応まで連携する。

知識財産処は、海外で拡大している偽造商品、商標の無断先取り、店舗の雰囲気の高模倣など、いわゆる「ニセモノ」への対応を強化するため、7月30日に「K-ブランド偽造品通報センター」と「K-ブランド保護サービス」を導入した。

(1) 偽造品を発見したら、写真で手軽に通報

「K-ブランド偽造品通報センター」は、海外の店舗、オンライン取引サイト、SNSなどで発見した偽造品の疑いがある事例を、オンラインで手軽に通報できるように設けられた窓口である。同センターは、韓国知識財産保護院が運営する「K-ブランド保護ポータル」内に開設され、通報専用のQRコード、画像・位置情報に基づく簡易通報機能などを提供して、現地からすぐ通報できるようになっている。

* <https://ip-navi.or.kr/kbrands/angel.do>



Travel, Enjoy, and Protect K-Brands!

Find, snap, and upload fake K-brands to get your Guardian Angel certificate and a 100% guaranteed reward. Don't miss out!



Home



Guide



Report



My

受理された通報は、韓国商標との類似性および誤認・混同の可能性、侵害の蓋然性などを検討した後、商号・看板の盗用、偽造商品の流通、韓流のアイデンティティの毀損など、侵害の類型別に分類し、データベース化する。有効な通報と判断された場合は、商標の権利者に迅速に通知し、その後の対応まで支援する。

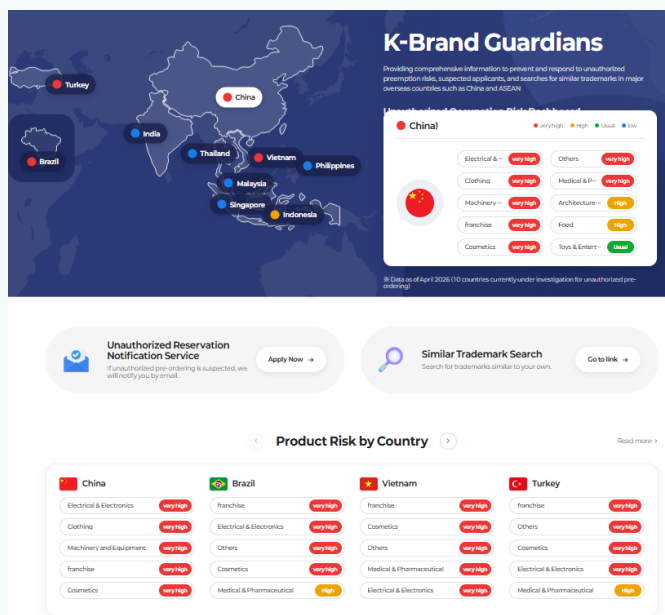
現地に商標権がある場合は、侵害の証拠収集、行政・刑事取り締まりなど、商標権侵害の対応へと連携し、現地に権利がない場合や権利関係が不明確な場合でも、不正競争行為や消費者保護法違反など、現地の法・制度に合わせて対応策を模索できるよう、K-商標の紛争対応戦略支援事業とも連携する計画である。

(2) AI・情報分析で海外商標の無断先取りリスクを事前警告

知識財産処はまた、韓国企業が海外で自社の商標が現地の者によって無断で登録されるリスクを事前に把握できるよう、「K-ブランド保護サービス*」も併せて提供する。このサービスは、海外の商標出願情報、無断先取りの履歴、出願人・代理人の繰り返し出願のパターン、韓国商標との類似度などを総合的に分析し、国別・業種別のリスクレベルおよび警告を提供する、紛争予防型のK-商標保護サービ

スである。

* <https://ip-navi.or.kr/kbrands/guard>



特に、「無断先取り通知サービス」に自らの商標を登録しておけば、海外で類似する商標の出願が確認された際に、国名と商標情報が自動的に電子メールで通知される。さらに、出願人・住所・代理人情報を基に、繰り返し出願、複数国への出願、指定商品の拡大などの出願パターンを分析し、商標ブローカーと見られる候補を特定して必要とする企業に提供し、かつ企業が商標名や写真を入力すれば、海外主要国の商標との類似度を確認できる機能も提供する。

今後も知識財産処は、通報センターの受付事例や保護サービスの分析結果に基づき、海外での商標無断先取りや偽造商品が頻発する国・業種を継続して管理する一方、必要に応じて現地の法的対応、取締機関との連携、海外取引先との協力など、事後対応の支援を拡大していく計画である。

知識財産処は、「K-商標が全世界で人気を博している中、これを模倣したり無断で便乗しようとする動きに対し、政府が実効性のある対応をすることが何よりも重要である」とし、「今後は、政府と企業だけでなく国民や消費者と共に、偽造品を通報し、正規品を購入する文化を広めるなど、海外におけるK-商標をより確実に保護するための多角的な対応体制を強化していく」と明らかにした。

「ウリハルメは自分の商標だ」と提訴

法院「特定の個人が独占できるものではない」

外食業界において「ハルメ(おばあちゃん)」は魔法の言葉である。看板に「ハルメ」が入った瞬間、その店は親しみがあり、量もたっぷり、深い手作りの味を感じさせる空間へと変貌する。

では、もし誰かが、「自分が先に『ウリハルメ(うちのおばあちゃん)』という商標を登録したのだから、他の店はこの名前を使ってはならない」と主張したらどうなるだろうか？

ソウル中央地方法院と特許法院で、全国規模の「ハルメ商標戦争」と呼ぶにふさわしい商標権侵害訴訟の結論が下された。法院は「ウリハルメは、特定の誰かだけのものにはなり得ない」とし、誰もが自由に使える言葉であることを明確にした。

事件の発端は、食品販売業などを営むA社が、フランチャイズ本部であるB社を相手取り、商標権侵害差止および5億ウォン(約5,700万円)の損害賠償を求める訴訟を起こしたことにあった。

A社は以前から、「ウリハルメ」という単語とともに、土鍋を手で微笑む、髪を後ろでお団子にまとめた老齢女性のイラストを商標として登録し、店舗を運営していた。

ところが、B社が「ウリハルメ」という名称を含むトッポッキのフランチャイズ事業を大々的に展開し、笑顔を浮かべたパーマヘアの中年女性のイラストを看板や包装紙などに使用したため、A社は「故意に同一・類似の標章を使用し、商標権を侵害された」として訴訟を提起した。

一審(ソウル中央地方法院)と二審(特許法院)の判断は一致した。原告であるA社の全面敗訴となった。

裁判部は判決文を通じて、我々が日常でよく使う言葉を特定の企業が独占することに対し、断固とした立場を明らかにした。

『ウリ(我々)』という言葉は、日常生活において極めて頻

繁かつ広範囲に使用される用語であり、いかなる者も何の制約もなく自由に使えるべきであり(中略)これは単なる個人的な次元や特定の部分的な領域を超えた、一般公共の利益に属するものである。」

「『ハルメ』は『ハルモニ』の方言であり、一般の消費者に『おばあちゃんが作ってくれる真心と愛情のこもった料理を提供する』というイメージを想起させる。多数の事業者が標識として使用しており、特定人に独占させることは適切ではない。」

つまり、「ウリ」と「ハルメ」という単語は、それ自体では他のブランドと区別される独自の識別力を発揮できないという意味である。二つの単語を組み合わせた「ウリハルメ」も同様に、新たな識別力は生じないと判断した。

裁判部はさらに、両社が使用するロゴに描かれた女性のイラストが明らかに異なることも指摘した。

裁判部は、両ロゴの外観が著しく異なるだけでなく、消費者が抱くイメージも、A社は包括的な「おばあちゃんが作ってくれた料理」であるのに対し、B社は「おばあちゃんが作ってくれたトッポッキ」に限定されているため、出所を誤認したり混同したりするおそれはないと判断した。

結果として、特許法院の裁判部は、「被告(B社)の実際の使用標章は、本事件登録商標と標章が類似していないため、商標権を侵害したとは認められない」として、A社の控訴および3億ウォン(約3,400万円)の予備的請求をいずれも棄却した。



韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA & HAにお任せ下さい

(調査、特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、
インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.com
Website : http://haandha.com

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail: st@stpat.co.kr